

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5351173号
(P5351173)

(45) 発行日 平成25年11月27日 (2013.11.27)

(24) 登録日 平成25年8月30日 (2013.8.30)

(51) Int.Cl.
A 6 1 M 37/00 (2006.01)F 1
A 6 1 M 37/00

請求項の数 7 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2010-538958 (P2010-538958)	(73) 特許権者	508079681
(86) (22) 出願日	平成20年10月17日 (2008.10.17)		デビオテック ソシエテ アノニム
(65) 公表番号	特表2011-508619 (P2011-508619A)		スイス国, セアッシュー 1 0 0 4 ローザ
(43) 公表日	平成23年3月17日 (2011.3.17)		ンヌ, アブニユ ドゥ セブラン 28,
(86) 国際出願番号	PCT/IB2008/054280		イムーブル “ル ポルティーク”
(87) 国際公開番号	W02009/077892	(74) 代理人	100099759
(87) 国際公開日	平成21年6月25日 (2009.6.25)		弁理士 青木 篤
審査請求日	平成23年8月29日 (2011.8.29)	(74) 代理人	100092624
(31) 優先権主張番号	07123416.5		弁理士 鶴田 準一
(32) 優先日	平成19年12月17日 (2007.12.17)	(74) 代理人	100102819
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)		弁理士 島田 哲郎
		(74) 代理人	100171251
			弁理士 篠田 拓也
		(74) 代理人	100123582
			弁理士 三橋 真二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 面外極微針の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ハット (2) 及びブリッジ (3) から作成されると共に構成下の各極微針 (1) の上で、同時に起こる極微針のネットワークの生成と、多角形状をしたハット (2) の生成とを含む面外極微針製造方法により得られる吊り構造であって、

前記方法がさらに、

- ハット (2) 同士の間にはブリッジ (3) を備える段階と、
- 残りの極微針の製造段階の間中、ブリッジ (3) を維持する段階と、
- 極微針 (1) が形成されたとき、ハット (2) と共にブリッジ (3) を除去する段階と、

を含み、かつ、

ブリッジ (3) が、少なくとも部分的に湾曲している、

吊り構造。

【請求項 2】

ブリッジ (3) が多層構造である、

請求項 1 に記載の吊り構造。

【請求項 3】

ブリッジ (3) が 3 層、すなわち 2 層の非伝導層の間に設けられる 1 層の伝導層で作られる、

請求項 2 に記載の吊り構造。

【請求項 4】

伝導層がアルミニウムで作られ、非伝導層が二酸化ケイ素から作られる、
請求項 3 に記載の吊り構造。

【請求項 5】

各ブリッジ (3) が直線部分と、1 / 2 円及び 1 / 4 円である円部分との組み合わせから
作られる、

請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の吊り構造。

【請求項 6】

同じウェハー (4) から製造されると共に請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の方法に
より得られる、極微針の組体。

10

【請求項 7】

二酸化ケイ素層が使用されるウェハーを提供することを含む面外極微針製造方法であっ
て、

前記方法がさらに、

- 極微針の先端を始める第 1 の等方性エッチングをする段階と、
- 極微針の頭部を画定する第 1 の異方性エッチングをする段階と、
- 極微針の肩部を始める第 2 の等方性エッチングをする段階と、
- 極微針の軸部を得る第 2 の異方性エッチングをする段階と、

極微針の先端と、後側の貫通孔と、極微針の最終的なデザインとをパターン形成す
る第 3 の等方性エッチングをする段階と、

20

を含む、

前記方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、ウェハー、例えばシリコンウェハーから製造される極微針に関する。この
発明による極微針は、体内に流体を経皮投与する医療分野に有利に使用されてもよい。

【背景技術】

【0002】

M E M S 極微針は、2つのグループ、すなわち面内 (i n - p l a n e) 極微針及び面
外 (o u t - o f - p l a n e) 極微針に分類され得る。第 1 のグループにおいて、極微
針の軸は、ウェハーに対して平行である一方、第 2 のグループにおいて、軸は、基板に
対して垂直である。面外極微針のグループは、2つの下位グループ、すなわち中空極微針及
び中実極微針にそれぞれ、分離され得る。中空極微針は、例えば、特許文献 1 及び特許文
献 2 において説明されるような貫通孔を有する。先行技術により開示された極微針の製造
方法は、様々な極微針の形状を得るために様々なデザインと、フォトリソグラフィとエ
ッチング (ドライエッチング及びウェットエッチングの両方又はその一方) との組み合わ
せとを使用する。全てのそれらの方法において共通の特徴は、形成時における各極微針の
上の一般的に二酸化ケイ素で作られる保護マスクの存在である。このマスクは、通常、“
ハット (hat)” と名づけられる。

30

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】国際公開 W O 2 0 0 2 / 0 1 7 9 8 5 号公報

【特許文献 2】国際公開 W O 2 0 0 3 / 0 1 5 8 6 0 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、いくつかの課題が、現状の極微針製造方法で観察される。例えば、面外
極微針の製造において、収率は、ウェハーの中央と境界との間のシリコンエッチ速度の違

50

いにより制限される。この違いのために、いくつかの極微針のハットは、方法の終了の前に（一般的にウェハーの周囲で）落下する。この結果、下方の極微針はもはや保護されず、結論として、もはや制御されたやり方でエッチングされない。したがって、課題、具体的には極微針の奇形及び低い生産収率が発生する。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記において論じられた課題は、製造方法の間中にハット同士の間と、ハットと縁部との間とでハットを結合するブリッジの生成により特徴付けられるこの発明による極微針の製造方法により解消され、又は、少なくとも著しく減少される。

【0006】

より正確に、この発明は、同時に起こる極微針のネットワークの生成と、形成時に各極微針の上での多角形状をしたハットの生成とを含む面外極微針製造方法に関し、その方法は以下の段階を含む：

- ハット同士の間にはブリッジを設ける段階、
- 残りの極微針の製造段階の間中、ブリッジを維持する段階、
- 極微針が形成されたとき、ハットと共にブリッジを除去する段階。

【0007】

本記載において、“多角形ハット”という語句は、端同士が互いに連結された直線からなる閉じられた形状として理解されなければならない。また、本記載の意義において“多角形ハット”は、円をも含む。この物体は、ゼロになる傾向がある直線を有する多角形としてみなされてもよい。

【0008】

ハットのように、ブリッジは、製造方法の最後で完全に取り除かれ、極微針のデザインの変更を生じない。

【0009】

好ましくは、ブリッジは、吊り構造でできている。ブリッジは、吊り構造の材料と極微針の製造方法とを両立できるデザインを有する。

【0010】

ブリッジは多くの様々なデザインを有してもよい。ある実施形態において、ブリッジは直線である。他の実施形態において、ブリッジは湾曲した部分を含む。有利に、各ブリッジは、直線部分と、円部分、例えば1/2円及び1/4円との組み合わせからなる。

【0011】

ブリッジの寸法は、極微針同士の間隔と、極微針とウェハーの縁部との間隔とに応じて変更することができる。ハットの厚さに関連付けられるブリッジの厚さは、100nm～100μmの間で変更することができ、ブリッジの幅は、1μm～100μmの間で変更することができる。

【0012】

さらに、機械抵抗などの特定の物理特性は、ブリッジのサイズ及び形状により影響される。

【0013】

使用される材料は、製造方法を支援するための適切な特性を有さなくてはならない。例えば、優れた伝導率を要求する方法のために、金属が選択されるであろう。互いに異なった特性が、例えば良好な伝導率、高い選択性及び変形に対する機械抵抗として要求されるとき、特に3層を有する複層ブリッジは、興味深い妥協を提案する。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】従来技術による極微針の製造方法を示す図。

【図2】この発明による極微針の製造方法を示す図。

【図3】図2において示される構成要素の上面図。

【図4】従来技術による極微針及びハットの組体の写真（ブリッジなし）。

10

20

30

40

50

【図 5】この発明によるブリッジの一実施例を示す図。

【図 6】この発明によるブリッジの他の実施例を示す図。

【図 7】この発明によるブリッジの他の実施例を示す図。

【図 8】この発明による 1 つのブリッジの他の実施例を示す図。

【図 9】図 5 において示される実施例の写真。

【図 10】除去の前（図 11 の前の状態）のハット及びブリッジを有する極微針の写真。

【図 11】この発明による方法により得られる極微針の写真。

【発明を実施するための形態】

【0015】

この発明は、上記の図によって説明される実施例と共に、より詳細に以下において論じられる。

10

【0016】

図 1 において説明されるような従来の MEMS 極微針製造方法は、通常ウェハー、好ましくはシリコンウェハー 4 から始める。このシリコンウェハーの頂部において、二酸化ケイ素層は、極微針をパターン形成するための保護マスクとして使用される。

【0017】

この方法は、互いから分離された複数の極微針を得ることを目的としており、結果として、段階 A における連続の保護マスクは、段階 B の極微針の構造化の当初において不連続になる。この不連続な保護マスクの部分は、ハット 2 と呼ばれ、各極微針は、ハットにより見落とされ、極微針を保護し、制御されかつ良好に形成された構造化作用を可能にする。図 4 は、ハット 2 の下の極微針 1 の作成の実施例を示す。

20

【0018】

極微針のこの構造化は、図 1 の段階 B ~ E において示されるように一連の等方性及び異方性のエッチングにより行われる。図 1 の段階 B において示されるような第 1 の等方性エッチングは、極微針の先端を始める。第 1 の異方性エッチング（図 1、段階 C）は、極微針の頭部の形成に使用される。図 1 の段階 D に示されるように第 2 の等方性エッチングの目的は、極微針の肩部を始め、第 2 の異方性エッチング（図 1、段階 E）の結果得られる軸部と極微針の頭部を分離することにある。この方法で最も重要なエッチングである最後の等方性エッチング（図 1、段階 F）は、最後に来る。このエッチングにより、極微針の先端と、後側の貫通孔と、極微針の最終的なデザインとがパターン形成される。次いで、図 1 の段階 G において示されるような酸化及び酸化ケイ素エッチングが、ハットを除去し、シリコンの表面を研磨するために実現される。

30

【0019】

頻繁に、ハットは、最後の方法の前に落下するおそれがある（図 1、段階 F の参照番号 2）。このことは、奇形及び低製造収率をもたらす、極微針の構造化が制御されないという状況を招来する。加えて、落下したハットは、図 1 の参照番号 5 に示されるように、劣悪な表面状態を招来する。

【0020】

この発明は、ハットが最後の方法の前に落下しないように、共にハットを保持するためのやりかたを提供する。この趣旨で、ハットは一緒に結合され、図 3 で示されるように縁部に結合される。また、本記載においてブリッジと名づけられるこれらの結合（図 2、参照番号 3）は、方法の最後まで所定の位置にとどまり、極微針の製造が終了されるまで（図 2、段階 F）各ハットの安定性を保証する。方法が完了されるとき（図 1、段階 G）、完全な極微針のパターン形状（例えば図 11 参照）及びチップ（chip）の表面状態を見せながら、ハット及びこれらの結合は取り除かれる。

40

【0021】

これらの結合の重要な利点は、これらが極微針の構造化パラメータを変更しないことである。等方性及び異方性エッチングは、結合を伴っても、伴わなくても同じである。

【0022】

以前に説明したように、ブリッジ及びハットは、深く結合され、実際のところ、ブリッ

50

ジ及びハットは、同じ材料で作られ、同じ厚さを有する。

【 0 0 2 3 】

ブリッジのデザインに関する限り、多くの形状を取ることができる。ハット同士の間の単純な直線ブリッジは、図 5 において概略的に、かつ、図 2 の段階 B の極微針の方法を示す図 9 の写真において示されるように、1 つの選択肢であり得る。

【 0 0 2 4 】

図 6 及び図 7 のように曲線部分、又は図 8 のように直線及び曲線部分の組み合わせもまた、可能である。

【 0 0 2 5 】

ブリッジのデザインの他の特徴は、材料である。単層ブリッジは、多くの方法に適することができるが、方法の複雑さ及びクリーニング段階にも応じて、多層ブリッジは、より良い選択肢となることができる。多層ブリッジは、ブリッジの特性を改善させる（図 1 0）。金属層（アルミニウム、タングステン、ニッケル等）及び非伝導層（二酸化ケイ素、窒化ケイ素等）を結合させてもよい。金属層は、ブリッジの熱伝導率を改善させ、非伝導層は、ブリッジの機械的な耐久性及び高い選択性を改善させる。

10

【 符号の説明 】

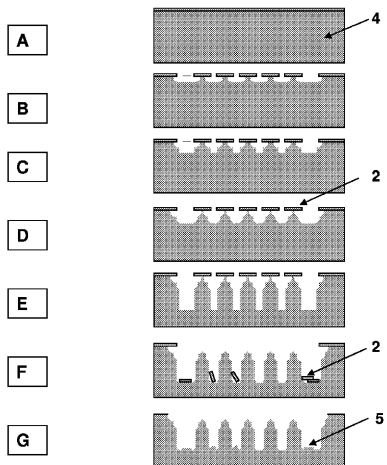
【 0 0 2 6 】

- 1 極微針
- 2 ハット
- 3 ブリッジ
- 4 ウェハー
- 5 被損傷域
- 6 直線部分
- 7 1 / 2 円
- 8 1 / 4 円
- 9 金属層
- 1 0 SiO_2 層

20

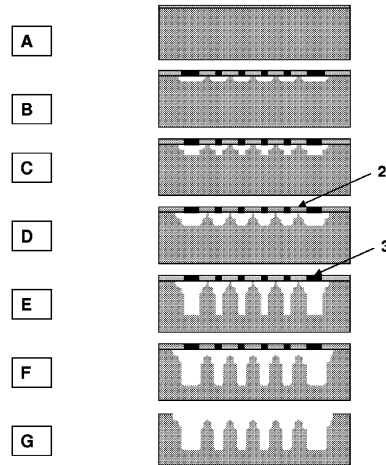
【図 1】

FIGURE 1



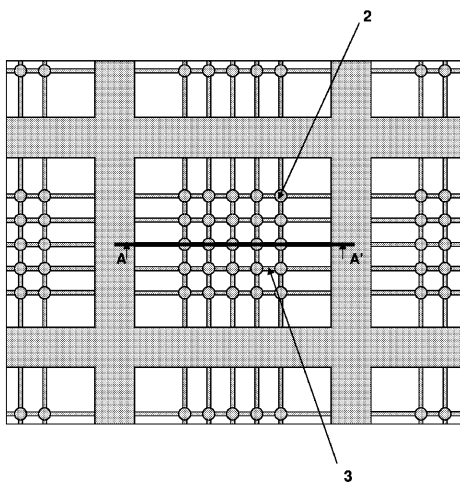
【図 2】

FIGURE 2 (AA')



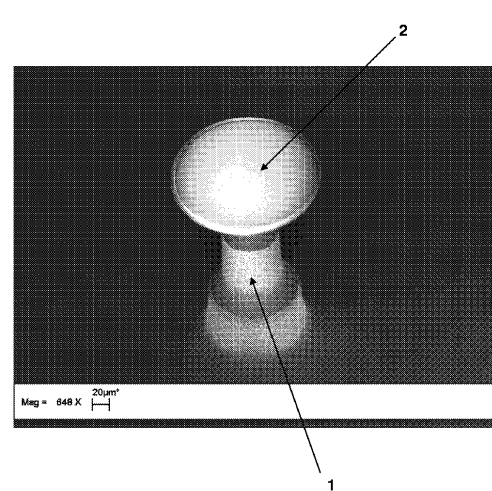
【図 3】

FIGURE 3



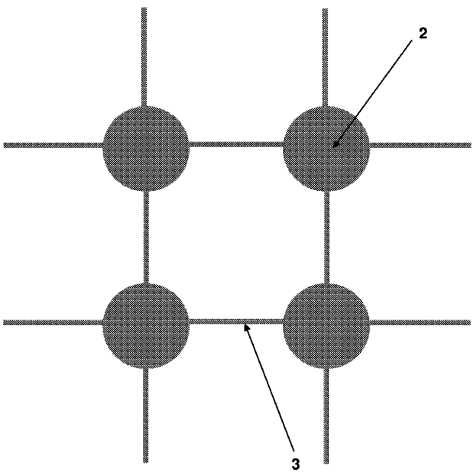
【図 4】

FIGURE 4



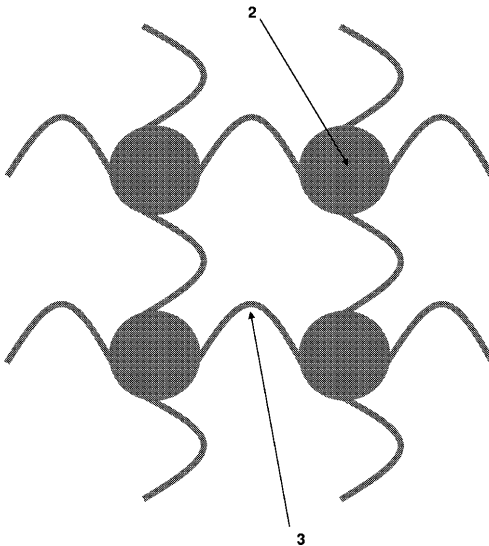
【 図 5 】

FIGURE 5



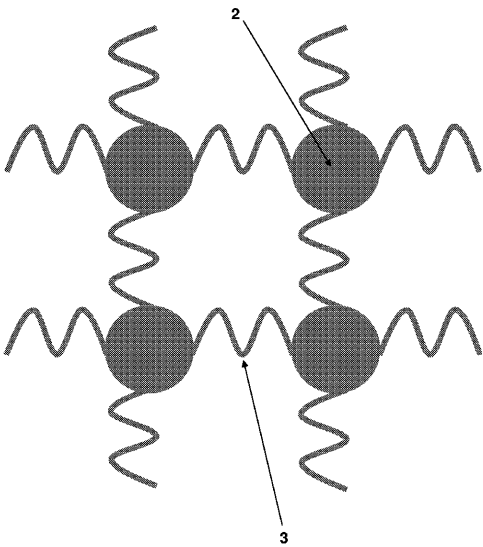
【 図 6 】

FIGURE 6



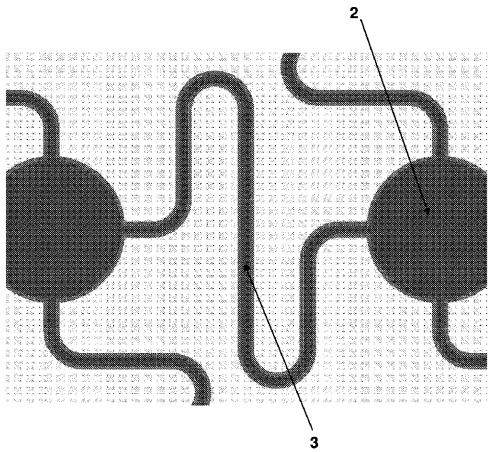
【 図 7 】

FIGURE 7



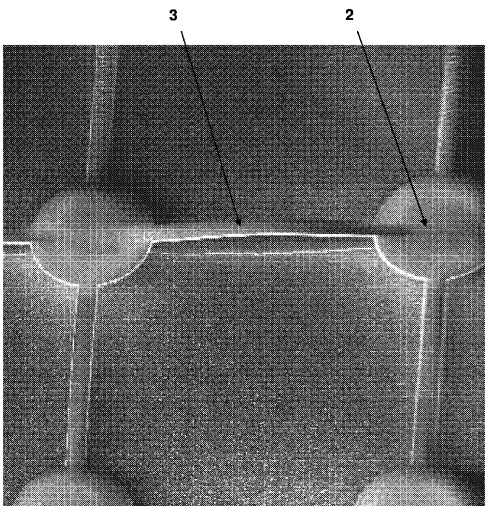
【 図 8 】

FIGURE 8



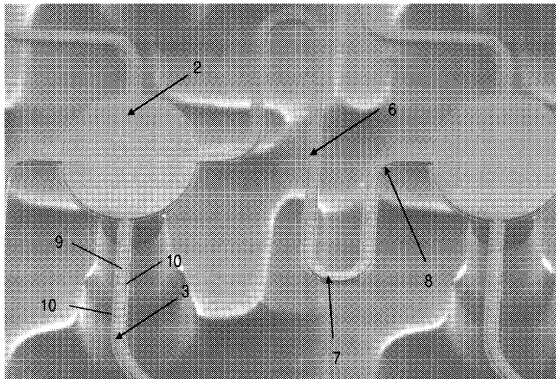
【 図 9 】

FIGURE 9



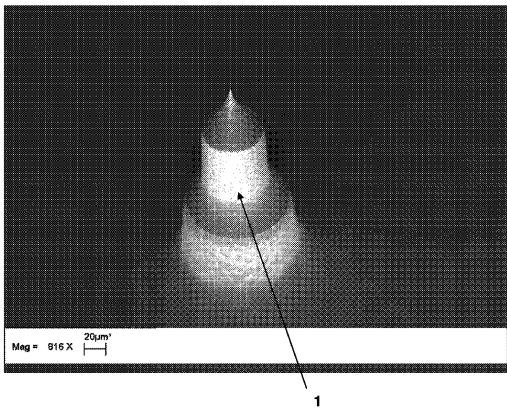
【 図 10 】

FIGURE 10



【 図 11 】

FIGURE 11



フロントページの続き

(74)代理人 100153729

弁理士 森本 有一

(72)発明者 カシュメール, アストリド

スイス国, セアッシュ - 1 0 0 4 ローザンヌ, アブニュ ドゥ セブラン 2 8, セノ オ デビ
オテック ソシエテ アノニム

(72)発明者 カヌアン, フランソワ

スイス国, セアッシュ - 1 0 0 4 ローザンヌ, アブニュ ドゥ セブラン 2 8, セノ オ デビ
オテック ソシエテ アノニム

審査官 田中 玲子

(56)参考文献 欧州特許出願公開第 0 1 6 6 9 1 0 0 (E P , A 1)

特開平 0 6 - 1 4 0 6 4 1 (J P , A)

特開 2 0 0 5 - 1 9 9 3 9 2 (J P , A)

特表 2 0 0 4 - 5 3 8 1 0 6 (J P , A)

国際公開第 2 0 0 8 / 0 0 3 5 6 4 (W O , A 1)

米国特許出願公開第 2 0 0 8 / 0 1 5 7 4 2 7 (U S , A 1)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

A 6 1 M 3 7 / 0 0

A 6 1 M 5 / 3 2

H 0 1 L 2 1 / 3 0 6